

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 2 月 17 日 (17.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/014743 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C09D 183/16, 171/00, 183/04, C01B 33/12, H01L 21/312 (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011135 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 4 日 (04.08.2004) (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-292529 2003 年 8 月 12 日 (12.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クラリアント インターナショナル リミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; 4132 ムッテンツ 1, ロートハウスシュトラーゼ 6 1 Muttensz (CH).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 青木 倫子 (AOKI, Tomoko) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜 3 8 1 0 クラリアントジャパン株式会社内 Shizuoka (JP). 青木 宏幸 (AOKI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1138662 東京都文京区本駒込 2-2 8-8 文京グリーンコート センターオフィス 9 階 クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COATING COMPOSITION AND LOW DIELECTRIC SILICEOUS MATERIAL PRODUCED BY USING SAME

(54) 発明の名称: コーティング組成物、およびそれを用いて製造した低誘電シリカ質材料

(57) Abstract: Disclosed is a coating composition which enables to easily produce a porous siliceous film which exhibits excellent mechanical strength, stably very low dielectric constant, and chemical resistance to various chemicals at the same time. Also disclosed is a method for producing a siliceous material using such a coating composition. The coating composition contains a polyalkyl silazane compound, an acetoxysilane compound and an organic solvent, and further a porosity imparting material, if necessary. Also disclosed are a siliceous material obtained by firing such a coating composition and a method for producing such a siliceous material.

(57) 要約: 本発明は優れた機械的強度を備え、かつ非常に低い誘電率を安定的に示し、各種の薬剤に対する耐薬品性を兼ね備えた多孔質シリカ質膜を簡便に製造することができるコーティング組成物とそれを用いたシリカ質材料の製造法を提供するものである。本発明によるコーティング組成物は、ポリアルキルシラザン化合物、アセトキシシラン化合物、有機溶媒、および必要に応じて多孔質化材、を含んでなる。本発明はそのコーティング組成物を焼成することにより得られたシリカ質材料、ならびにその製造法にも関する。

WO 2005/014743 A1